

©1994

**ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
КРИСТАЛЛОВ $\text{Li}_2\text{Ge}_7\text{O}_{15}:\text{Cr}$
И ЛЮКС-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТАЦИОНАРНОГО ФОТОТОКА
В ПРИМЕСНЫХ ДИЭЛЕКТРИКАХ**

*С.А.Басун, А.А.Каплянский, С.П.Феофилов,
О.К.Мельников, Б.К.Севастьянов*

Стационарный фототок j , связанный с двухступенчатой фотоионизацией примесных ионов Cr^{3+} в решетке $\text{Li}_2\text{Ge}_7\text{O}_{15}$ (LGO), измерен в зависимости от мощности оптической накачки P ($T=77$ К). В кристаллах LGO:Cr $j \sim P^2$, в то время как в кристаллах с соактиватором LGO:Cr,Mg $j \sim P^{3/2}$. Это различие в ходе $j(P)$ связывается с различием в исходной концентрации n_+^0 центров рекомбинации для фотоэлектронов (ионы Cr^{4+}). В LGO:Cr $n_+^0 \gg n^*$, а в LGO:Cr,Mg $n_+^0 \ll n^*$, где n^* — концентрация Cr^{4+} , образуемых при оптическом возбуждении за счет фотоионизации Cr^{3+} . При этом в отличие от случая LGO:Cr в случае LGO:Cr,Mg чрезвычайно важны захват и оптическое возбуждение фотоэлектронов с глубоких ловушек. Проанализирован ход стационарного фототока $j(P)$ для примесных диэлектриков в зависимости от содержания примесных ионов в разном зарядовом состоянии и от различных условий прилипания фотоносителей на ловушках.

Исследования фототока, возникающего при ионизации светом примесных ионов в диэлектриках, дают ценную информацию об энергетической схеме всей системы «кристалл плюс примесь», о процессах фотоионизации примеси, об электронном транспорте фотоносителей в решетке и их рекомбинации. Эти исследования представляют интерес для многих применений диэлектриков, использующих процессы фотоионизации примесей (фоторефрактивные среды для записи голограмм, проблема стабильности активированных лазерных кристаллов в условиях сильной оптической накачки, выжигание узких спектральных пропалов в неоднородно-уширенных спектрах примесей и т.д.). Одним из наиболее прямых экспериментальных методов изучения фотоэлектрических свойств диэлектриков является измерение стационарного фототока приложении постоянного напряжения. Важнейшей экспериментальной характеристикой стационарного фототока является его зависимость от мощности оптической накачки (люкс-амперная характеристика), которая в принципе содержит информацию о всех этапах сложного фотоэлектрического процесса..

В настоящей работе (см. также [1]) исследуется стационарная фотопроводимость диэлектрических кристаллов гептагерманата лития

$\text{Li}_2\text{Ge}_7\text{O}_{15}$, активированных ионами Cr^{3+} . Ионы Cr^{3+} в ромбической решетке LGO замещают ионы Ge^{4+} в октаэдрическом (6O^{2-}) окружении и имеют [2] характерные оптические спектры Cr^{3+} , находящегося в сильном кристаллическом октаэдрическом поле: широкие полосы поглощения $U(^4A_2 \rightarrow ^4T_2)$, $Y(^4A_2 \rightarrow ^4T_1)$, узкие R -линии ($^4A_2 - ^2E$), наблюдавшиеся в поглощении и в люминесценции. В спектрах LGO: Cr^{3+} ранее исследовался ряд интересных явлений: псевдоштарковское расщепление R -линий в электрическом поле [3], эффекты фазового перехода $D_{2h} - C_{2v}$ [4,5], влияние неравновесных фононов [3].

В [2] была обнаружена весьма сильная для диэлектриков фотопроводимость кристаллов LGO: Cr^{3+} при возбуждении в полосы поглощения Cr^{3+} . При возбуждении в 4T_2 , 4T_1 полосы наблюдался стационарный фототок, квадратично зависящий от интенсивности накачки. Этот результат, а также кинетика фототока [6] показывали, что фотоионизация Cr^{3+} связана с двухквантовыми процессами, в основном — с последовательной двухступенчатой оптической ионизацией ионов Cr^{3+} через метастабильное возбужденное 2E -состояние.

Большая фотоэлектрическая чувствительность LGO: Cr^{3+} делает эти кристаллы весьма удобными для изучения общих свойств фотоэлектрических процессов в диэлектриках с примесными ионами. Эти процессы существенно связаны с фотостимулированной перезарядкой примесных ионов и зависят от содержания в кристалле примесных ионов в разном валентном (зарядовом) состоянии (см., например, [7,8]). Исходя из этого, в настоящей работе исследованы фотоэлектрические свойства кристаллов LGO: Cr , отличающихся соотношением концентрации примесных ионов разной валентности.

1. Зависимость фототока от интенсивности оптического возбуждения

Экспериментальные результаты. В работе использовались монокристаллы LGO: Cr (0.05%) и монокристаллы LGO: Cr (0.02%), Mg (0.02%), содержащие наряду с Cr добавку соактиватора Mg. Образцы представляли собой тонкие ($d = 0.2$ mm) пластинки, на грани которых нанесены прозрачные SnO_2 электроды. Образцы помещались в жидкий азот ($T=77$ K) или откачиваемый жидкий гелий ($T=2$ K). К электродам прикладывалось постоянное напряжение, создающее в образце однородное электрическое поле $E \sim 10^5$ V/cm. Образец возбуждался через электроды светом непрерывного лазера. Стационарный фототок измерялся с помощью электрометрического усилителя с постоянной времени 10 s. Темновая проводимость была неизмеримо малой.

В образцах обоих типов LGO: Cr и LGO: Cr, Mg наблюдалась фотопроводимость при возбуждении Ar лазером (линии в области 457.9–514.5 nm), а также He–Ne лазером (632.8 nm) и лазером на красителе в районе R -линий (~700 nm). При возбуждении Ar лазером зависимость фототока от длины волны линии возбуждения в общем коррелируют со спектром возбуждения люминесценции Cr^{3+} для обоих типов образцов.

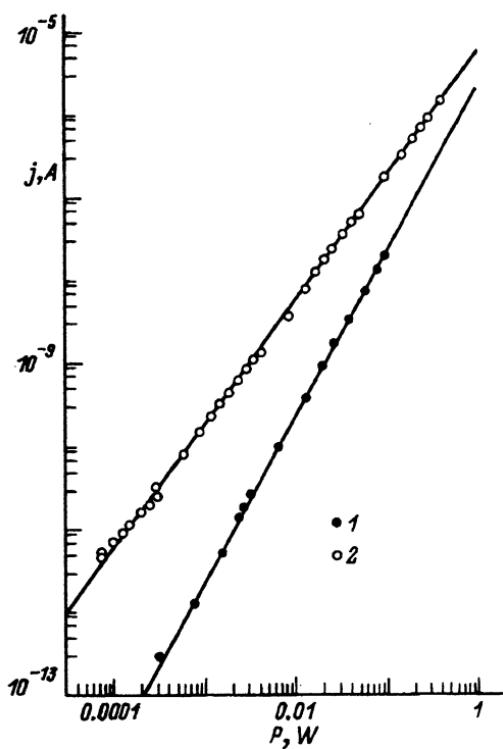


Рис. 1. Зависимость величины фототока j от интенсивности оптической накачки P .

1 — образец LGO:Cr. Прямая линия — $j \sim P^2$. $T=77$ K, $E=100$ kV/cm, возбуждение 514.5 nm, диаметр лазерного луча 0.2 mm; 2 — образец LGO:Cr,Mg. Прямая линия — $j \sim P^{3/2}$. $T=77$ K, $E=100$ kV/cm, возбуждение 514.5 nm, диаметр лазерного луча 0.5 mm.

В образцах LGO:Cr при возбуждении в области U и Y полос в соответствии с [3] наблюдается квадратичная зависимость стационарного фототока j от плотности оптического возбуждения P ($j \sim P^2$; рис. 1). При этом стационарный ток в этих образцах устанавливается при изменении накачки за времена порядка постоянной времени измерительной схемы (≈ 10 s).

В образцах LGO:Cr,Mg при возбуждении в области U и Y полос зависимость $j(P)$ оказывается существенно иной. В области больших и средних плотностей наблюдается зависимость $j \sim P^{3/2}$ (рис. 1). Следует отметить, что в измерениях $j(P)$, проводимых при продвижении от больших плотностей возбуждения к малым, значение (меньшее) стационарного тока устанавливается достаточно долго, причем время достижения стационарного значения тока тем больше, чем меньше накачка P . Это обстоятельство не позволило продолжить измерения хода $j(P)$ в область малых накачек ($\sim 10^{-4}$ W, линия 514.5 nm при диаметре возбуждаемого объема ~ 1 mm), где время установления стационарного тока достигает уже многих десятков минут.

Таким образом, фототок в образцах LGO:Cr и LGO:Cr,Mg, будучи несомненно связанным с возбуждением ионов Cr^{3+} , принципиаль-

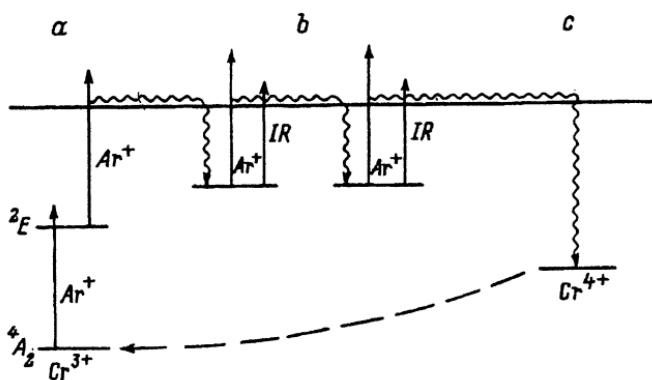


Рис. 2. Схема динамических процессов, происходящих в кристаллах LGO с Cr в условиях их стационарного оптического возбуждения: двухступенчатая генерация электронов ($G \sim P^2$) (a), захват на глубоких ловушках и фотовысвобождение (b), рекомбинация на Cr^{4+} (c).

но отличается как по своим люкс-амперным характеристикам ($j \sim P^2$ и $j \sim P^{3/2}$ соответственно),¹ так и по кинетике установления стационарного тока: в LGO:Cr кинетика быстрая, в LGO:Cr,Mg — длинная и зависящая от плотности накачки.

Обсуждение. Ниже обсуждается модель, объясняющая основные экспериментальные результаты работы.

На рис. 2 схематически изображены динамические процессы, происходящие в кристаллах LGO с Cr в условиях их стационарного оптического возбуждения. Наблюдение фототока в области U , Y полос и R -линий Cr^{3+} показывает, что свет вызывает фотоионизацию ионов Cr^{3+} , в результате чего электрон попадает в зону проводимости, а ион Cr^{3+} превращается в Cr^{4+} . При этом фотоионизация Cr^{3+} осуществляется в результате двухступенчатого процесса через возбужденное метастабильное 2E состояние иона Cr^{3+} . Находясь в зоне проводимости, оторванный от Cr^{3+} электрон рассеивается на дефектах и колебаниях решетки. Он также может захватываться на ловушки — «мелкие», с которых возможно термическое высвобождение электрона, и «глубокие», из которых электрон может быть высвобожден только оптически в результате поглощения кванта света (в том числе света, вызывающего рассматриваемую двухступенчатую фотоионизацию Cr^{3+}). Мы считаем, что в исходном кристалле, не подвергаем оптическому возбуждению, все ловушки пусты — они заполняются только фотоэлектронами, возникающими при двухступенчатой фотоионизации Cr^{3+} . Замыкающим циклом процессом является рекомбинация фотоэлектрона на ионе Cr^{4+} с превращением последнего в Cr^{3+} ($e + \text{Cr}^{4+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$). В условиях стационарной оптической накачки (мощность P) устанавливается ди-

¹ Известно, что на вид люкс-амперных характеристик в принципе могут влиять также процессы в приконтактных областях. В связи с этим отметим, что вольт-амперные характеристики для обоих типов образцов линейны от 0 до 10 V и слегка сверхлинейны в области больших приложенных напряжений. Таким образом, свойства SnO_2 -электродов, напыленных на кристаллы LGO, весьма близки к омическим и не оказывают заметного влияния на форму люкс-амперных характеристик.

намическое равновесие, характеризуемое (зависящими от P) концентрациями электронов, находящихся в зоне проводимости и на уровнях ловушек, а также концентрациями ионов Cr в разных зарядовых (Cr^{3+} , Cr^{4+}) и энергетических ($\text{Cr}^{3+}, {}^4A_2, {}^2E$) состояниях.

Фотоэлектрические измерения, очевидно, детектируют фотоэлектроны, находящиеся в «зонном» состоянии, поскольку дрейф этих свободных электронов в приложенном к образцу электрическом поле приводит к измеряемому фототоку. Зависимость стационарного фототока j от интенсивности оптической накачки P в различных условиях прилипания и рекомбинации photoносителей может быть в принципе получена из решения системы балансных уравнений, описывающих заселенность зонных и ловушечных состояний и зарядовый состав Cr (Cr^{3+} , Cr^{4+}) в условиях оптической накачки. Однако для получения качественной функциональной зависимости $j(P)$ мы используем ниже несколько иной подход, основанный на рассмотрении элементарного замкнутого цикла микроскопических процессов с участием одного фотоэлектрона — от его генерации при двухступенчатой фотоионизации иона Cr³⁺ до его рекомбинации на ионе Cr⁴⁺.

В рамках этого подхода величину стационарного фототока определяет важнейший параметр упомянутого цикла — среднее время T , которое фотовозбужденный электрон проводит как свободный (зонный) электрон и которое пропорционально (см., например, [9]) среднему пути S , проходимому электроном в кристалле от точки фотоионизации Cr³⁺ до точки рекомбинации электрона $e + \text{Cr}^{4+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$

$$T \sim S = (\sigma_r n_+)^{-1}, \quad (1)$$

где n_+ — концентрация центров рекомбинации (ионов Cr⁴⁺), а σ_r — сечение рекомбинации электронов на этих центрах. Именно в течение времени T возможен дрейф фотогенерированного электрона под действием электрического поля. При стохастической траектории движения электрона, обусловленной как процессами рассеяния, так и процессами перезахвата на ловушках, средний сдвиг L фотоэлектрона в пространстве под действием электрического поля E $L = \mu ET$ (μ — дрейфовая подвижность электрона, время T не зависит от E). Связанная с этим сдвигом плотность фототока

$$j = eGL \sim G\mu ET \sim GE(n_+)^{-1}, \quad (2)$$

где e — заряд электрона; G — темп фотоионизации, который пропорционален концентрации n_0 ионов Cr³⁺ ($G \sim n_0$) и может также зависеть от поля E .

Как видно из (2), фототок обратно пропорционален концентрации центров рекомбинации n_+ , которая в общем случае равна

$$n_+ = n_+^0 + n_+^*, \quad (3)$$

где n_+^0 — исходная постоянная концентрация ионов Cr⁴⁺, существующая в образце; n_+^* — зависящая от оптической накачки концентрация

Cr^{4+} , дополнительно созданная в кристалле за счет фотоионизации ионов Cr^{3+} .

В одном крайнем случае $n_+^0 \gg n_+^*$ исходная концентрация центров рекомбинации Cr^{4+} велика и намного превышает созданную при оптической накачке. В этой ситуации в (2) концентрация $n_+ = n_+^0 = \text{const}$ и фототок пропорционален темпу генерации фотоэлектронов

$$j \sim G(P), \quad (4)$$

который целиком определяет характер зависимости тока от интенсивности возбуждения $j(P)$. Мы полагаем, что эта ситуация реализуется для кристаллов LGO:Cr, причем фотоионизация ионов Cr^{3+} осуществляется двумя квантами света через возбуждение в 2E -состояние [3], из-за чего в (4) темп ионизации $G \sim P^2$ и $j \sim P^2$, что наблюдается на опыте (рис. 1).

В другом крайнем случае, когда $n_+^0 \ll n_+^*$, можно считать, что ионы Cr^{4+} в исходном материале вообще отсутствуют и центры рекомбинации Cr^{4+} образуются исключительно за счет оптической фотоионизации Cr^{3+} . В этом случае (2) имеет вид

$$j(P) \sim G(P)n_+^*(P)^{-1} \quad (5)$$

и зависимость $j(P)$ определяется зависимостью от P как G , так и n_+^* . Мы полагаем, что этот случай имеет место для кристаллов LGO:Cr,Mg при двухфotonной фотоионизации ионов Cr^{3+} через промежуточное 2E -состояние ($G \sim P^2$) и в условиях, когда концентрация $n_+^* \sim P^{1/2}$. В этом случае формула (5) дает $j \sim P^{3/2}$, что и наблюдается на опыте.

Покажем теперь, что предполагаемая зависимость $n_+^* \sim P^{1/2}$ имеет место в ситуации, когда электрон в промежутке между генерацией и рекомбинацией эффективно захватывается на очень глубокие ловушки, на которых он проводит основное время и из которых он освобождается только оптически при однофотонном поглощении кванта света накачки. В этих условиях, когда вероятность захвата электрона на глубокие ловушки велика по сравнению с вероятностью его фотоосвобождения, концентрация свободных электронов $n_e \sim Pn_e^l$, где n_e^l — концентрация ловушек, захвативших электрон, которая равна $n_e^l \approx n_+^*$ (почти полное залипание на ловушках фотоэлектронов, концентрация которых равна числу n_+^* фотоионизированных ионов Cr^{3+}). В рассматриваемом стационарном случае свободные электроны в зоне проводимости создаются в основном за счет однофотонной ионизации заполненных глубоких ловушек, а не за счет двухфotonной фотоионизации ионов Cr^{3+} . Из уравнения баланса между генерацией и рекомбинацией электронов, определяющего стационарную (для данного уровня возбуждения P) концентрацию n_+^* , следует

$$G(n_0) \sim n_e n_+^* \sim n_e^l P n_+^* \sim P(n_+^*)^2, \quad (6)$$

где n_0 — концентрация ионов Cr^{3+} ($n_0 + n_+^* = N$ — полная концентрация ионов хрома). При не слишком сильных накачках, когда $n_+^* \ll N$ и

$n_0 \approx N$, можно считать, что генерация G не зависит от степени ионизации ансамбля ионов Cr. Из (6) тогда следует, что $G \sim (n_+^*)^2 P$, и для случая двухфотонной ионизации ионов Cr^{3+} ($G \sim P^2$) выражение для n_+^* приобретает вид

$$n_+^* \sim (G/P)^{1/2} \sim P^{1/2}, \quad (7)$$

что объясняет наблюдаемую на опыте зависимость $j \sim P^{3/2}$.

Таким образом, различие в основном характере зависимостей фототока от накачки $j(P)$ у образцов LGO:Cr ($j \sim P^2$) и LGO:Cr,Mg ($j \sim P^{3/2}$) объясняется различием в исходной концентрации n_+^0 центров рекомбинации Cr^{4+} в образцах двух типов. В LGO:Cr n_+^0 намного больше концентрации n_+^* , создаваемой при оптическом возбуждении. В LGO:Cr,Mg ситуация обратная: исходно центры рекомбинации Cr^{4+} отсутствуют и только оптическое возбуждение приводит к образованию конечной концентрации центров (n_+^*).

Предположение о малой исходной концентрации Cr^{4+} в кристаллах LGO:Cr,Mg согласуется с представлениями о роли заряда соактиватора в регулировании соотношения концентрации разнозаряженных ионов основной активирующей примеси в кристалле. В LGO ионы Cr^{3+} замещают ионы Ge^{4+} и требуется зарядовая компенсация — локальная или нелокальная. Локальная компенсация обеспечивается, например, нестехиометрическим Li^+ в междоузлии [3,10]. При этом часть ионов хрома может входить в кристалл LGO:Cr в виде Cr^{4+} . В двухактивированном LGO:Cr,Mg за счет зарядовой компенсации концентрация Cr^{4+} может быть в принципе подавлена до нуля, если ионы Mg^{2+} , привнося лишний положительный заряд, замещают Li^+ (как это естественно считать исходя из величин ионных радиусов Li^+ , Mg^{2+} и Ge^{4+}).

Следует отметить, что в принятой схеме объясняется не только различие в ходе $j(P)$ в кристаллах LGO:Cr и LGO:Cr,Mg, но и существенное различие в кинетике установления стационарного тока. Действительно, в случае LGO:Cr,Mg эта кинетика должна быть намного длиннее, так как требуется определенное время для создания стационарной концентрации n_+^* . Это время должно укорачиваться с интенсивностью накачки P , поскольку освещение, делокализуя электроны из ловушек, способствует их продвижению к центрам рекомбинации Cr^{4+} и тем самым убыстряет рекомбинацию. Именно эта закономерность — замедление кинетики установления стационарного фототока с уменьшением P — наблюдалась на опыте у образцов LGO:Cr,Mg.

Важно подчеркнуть совершенно различную роль в образовании фототока процессов прилипания фотоэлектронов на ловушках в рассматриваемых двух случаях LGO:Cr,Mg и LGO:Cr, отвечающих крайним вариантам соотношения исходной концентрации n_+^0 центров рекомбинации Cr^{4+} и их фотоиндуцированной концентрации n_+^* , образующейся в кристалле при оптической накачке за счет фотоионизации Cr^{3+} . Действительно, оптическая накачка в случае LGO:Cr,Mg ($n_+^* \gg n_+^0$) играет двоякую роль: свет ионизует ионы Cr^{3+} в двухфотонном процессе с образованием фотоэлектронов и, кроме того, высвобождает в однофотонном процессе фотоэлектроны из глубоких ловушек. Послед-

ний процесс делокализации электронов убыстряет рекомбинацию фотоэлектронов на ионах Cr^{4+} , что уменьшает, очевидно, стационарную концентрацию n_+^* самих центров рекомбинации, существенно определяющую величину фототока (2). В противоположность LGO:Cr,Mg в кристаллах LGO:Cr, где концентрация центров рекомбинации n_+^0 исходно велика и мало меняется при накачке ($n_+^0 \gg n_+^*$), процессы прилипания на глубоких ловушках и оптического высвобождения фотоэлектронов, вообще говоря, никак не влияют на средний путь (S), проходимый электроном от точки рождения (фотоионизация Cr^{3+}) до точки рекомбинации на Cr^{4+} , и, таким образом, эти процессы не должны влиять на определяемую (2) величину фототока.

Сделанные выше выводы относительно различной роли процессов прилипания и оптического высвобождения photoносителей из глубоких ловушек в LGO:Cr и LGO:Cr,Mg нашли прямое подтверждение в обнаруженном недавно принципиальном различии воздействия ИК-подсветки (1.06μ) на возбуждаемый Ag лазером фототок в LGO:Cr и LGO:Cr,Mg [1,11]. В LGO:Cr,Mg, наблюдалось сильное возрастание фототока при ИК-подсветке, что связано с ИК-высвобождением электронов из глубоких ловушек, увеличивающим темп рекомбинации, и уменьшением вследствие этого концентрации центров рекомбинации. Наоборот, в LGO:Cr ИК-подсветка практически не влияет на фототок. Опыты с ИК-возбуждением прямо подтвердили и справедливость утверждения о незаполненности глубоких ловушек в LGO:Cr,Mg в отсутствие накачки.

2. Люкс-амперные характеристики стационарного фототока в примесных диэлектриках

Результаты исследований фототока в кристаллах LGO с регулируемым содержанием разнозарядных ионов Cr подтверждают принятую в работе картину явления фотопроводимости. В число микроскопических элементарных процессов, определяющих стационарный фототок, входят 1) фотоионизация примесного иона, находящегося в «основном» для него зарядовом состоянии; 2) дрейф в электрическом поле носителя в зоне, прерываемый актами захвата-освобождения на ловушках (которые пусты в исходном кристалле, не подвергнутом оптическому возбуждению); 3) рекомбинация носителя на ионизированной примеси, концентрация которой n_+ определяется как ее исходной концентрацией n_+^0 , так и концентрацией n_+^* , созданной при фотоионизации основной примеси. При этом зависимость величины стационарного фототока от оптической накачки является, как видно, чувствительной характеристикой отдельных процессов триады, составляющей элементарный цикл. Представляет интерес рассмотреть ход $j(P)$ не только для случая двухфотонной фотоионизации примеси, когда темп генерации $G \sim P^2$ (как это имеет место здесь для Cr^{3+} в LGO), но и для случая однофотонной фотоионизации примеси ($G \sim P$).

Результаты рассмотрения для одно- и двухфотонной ионизации примеси представлены в таблице. В первом столбце таблицы рассмотрен крайний случай большой исходной концентрации центров реком-

	$n_+^0 \gg n_+^*$	$n_+^0 \ll n_+^*$	
		фотовысвобождение ловушек	термовысвобождение ловушек
	1	2	3
Двухфотонная генерация, $G \sim P^2$	$j \sim P^2$	$j \sim P^{3/2}$	$j \sim P$
Однофотонная генерация, $G \sim P$	$j \sim P$	$j \sim P$	$j \sim P^{1/2}$

бинации $n_+^0 \gg n_+^*$, который отвечает практически фиксированной концентрации центров рекомбинации. В этом случае зависимость тока от накачки определяется по формуле (4) исключительно зависимостью от P темпа генерации носителей при фотоионизации примеси: $j \sim P^2$ для двухфотонной и $j \sim P$ для однофотонной ионизации; стационарный ток не зависит, вообще говоря, от процессов прилипания фотоэлектронов на ловушках. Второй и третий столбцы таблицы соответствуют противоположному крайнему случаю, когда центры рекомбинации в исходном кристалле практически отсутствуют и создаются лишь при оптическом возбуждении за счет фотоионизации примеси. В этом случае для зависимостей $j(P)$ существенны процессы прилипания фотоэлектронов на ловушках и высвобождения, поскольку эти процессы влияют на темп рекомбинации fotoносителей и тем самым на концентрацию создаваемых светом центров рекомбинации.

Второй столбец таблицы отвечает ситуации (аналогичной рассмотренной выше для LGO:Cr,Mg) эффективного захвата фотоэлектронов на глубокие ловушки, из которых носители оптически освобождаются в однофотонных переходах тем же светом, который производит фотоионизацию примеси. Эта ситуация описывается формулой (5) с концентрацией n_+ из (7), что приводит к общему выражению для тока

$$j \sim (GP)^{1/2}, \quad (8)$$

для двухфотонной ионизации $j \sim P^{3/2}$, для однофотонной $j \sim P$.

Третий столбец таблицы отвечает наличию только «мелких ловушек», освобождение из которых происходит термически и не требует оптического возбуждения, что практически эквивалентно случаю свободных носителей. В этом случае (хорошо известном для полупроводников) концентрация центров рекомбинации $n_+^* \sim G^{1/2}$ и в соответствии с (5)

$$j(P) \sim G^{1/2}, \quad (9)$$

что дает $j \sim P$ для двухфотонной и $j \sim P^{1/2}$ для однофотонной ионизации примеси.

Как видно из таблицы, зависимость стационарного фототока от накачки является весьма информативной характеристикой физических

процессов, определяющих явление фотопроводимости в примесном диэлектрике. В таблице рассмотрены крайние случаи соотношения исходной концентрации центров рекомбинации n_+^0 и создаваемой при фотоионизации n_+^* . Очевидно, что это соотношение само зависит от мощности накачки, увеличивающей n_+^* . Реально это должно проявиться на опыте в переходе с ростом P от зависимости $j(P)$ (см. таблицу, первый столбец) к более плавному ходу $j(P)$, соответствующему второму или третьему столбцу (кроме случая однофотонной ионизации и оптически ионизуемых ловушек, где всегда $j \sim P$).

Авторы благодарны В.И.Перелю, М.И.Дьяконову и М.Б.Мельникову за полезные обсуждения.

Список литературы

- [1] Basun S.A., Feofilov S.P., Kaplyanskii A.A. // J. Lumin. (in press); Proc. of IX Int. Conf. on the Dynamical Processes in Excited States of Solids. Cambridge, MA, USA, 1993.
- [2] Powell R.C. // J. Appl. Phys. 1968. V. 39. P. 4517–4521; Phys. Rev. 1968. V. 173. P. 358–366.
- [3] Basun S.A., Feofilov S.P., Kaplyanskii A.A., Bykov A.V., Sevastyanov B.K., Sharonov M.Yu. // J. Lumin. 1992. V. 53. P. 24–27.
- [4] Басун С.А., Каплянский А.А., Феофилов С.П. // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 56. № 1. С. 49–54; Basun S.A., Feofilov S.P., Kaplyanskii A.A. // Ferroelectrics. 1993. V. 143. P. 163–170.
- [5] Басун С.А., Каплянский А.А., Феофилов С.П. // ФТТ. 1992. Т. 34. № 11. С. 3377.
- [6] Kaplyanskii A.A., Basun S.A., Feofilov S.P. // Proc. of the XII Int. Conf. on Defects in Insulating Materials (Nordkirchen, Germany, Aug. 1992) / Ed. O. Kanert and J-M. Spaeth. World Scientific, Singapore, 1993. V. 1. P. 386–388.
- [7] Kratzig E. // Ferroelectrics. 1978. V. 21. N 1–4. P. 635–636.
- [8] Sommerfeldt R., Holtman L., Kratzig E. // Ferroelectrics. 1989. V. 92. P. 219–225.
- [9] Мотт Н., Герни Р. Электронные процессы в ионных кристаллах. М.: ИЛ, 1950.
- [10] Галеев А.А., Хасанов Н.М., Быков А.В., Винокуров В.М., Низамутдинов Н.М., Булка Г.Р. Спектроскопия, химия и реальная структура минералов и их аналогов. Казань, Казанский университет, 1990. С. 77–92.
- [11] Басун С.А., Каплянский А.А., Феофилов С.П., Мельников О.К., Севастьянов Б.К. // ФТТ. 1994. Т. 36, в печати.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
13 декабря 1993 г.